

## Monolit technika 2015 tavasz Zárthelyi kérdések

### A csoport

- 1) Memóriák felosztásai az eszköz funkciója szerint
- 2) Memóriák felosztásai működési elv, illetve technológia szerint
- 3) A Si egykristály szelet előállításának lépései
- 4) Oxidnövesztés Si egykristály felületén (változatok, kémiai reakciók, gyakorlati megvalósítás)
- 5) Az npn és pnp tranzisztor megvalósítása a szabványos (legegyszerűbb) monolit IC technológiával (keresztmetszet, a rétegek adalékolása és funkciója)

### B csoport

- 1) Memóriák felosztásai működési elv, illetve technológia szerint
- 2) Memóriák felosztásai az eszköz funkciója szerint
- 3) A Si egykristály szelet tulajdonságai és ezek vizsgálata
- 4) Oxidnövesztés Si egykristály felületén (változatok, kémiai reakciók, gyakorlati megvalósítás)
- 5) Az ellenállások megvalósítása a szabványos (legegyszerűbb) monolit IC technológiával (keresztmetszet, a rétegek adalékolása és funkciója)